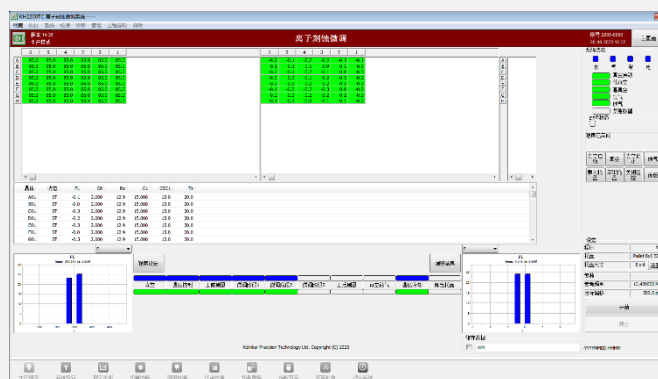


KH2200TC

离子刻蚀微调机(独立温控)



載盘加温下
(紅外線测温图像)



简介

- 采用离子刻蚀方式对晶体进行频率微调
- 每盘可放48只晶体，最多8只晶体进行同步微调⁽¹⁾，温度可控範圍，由 室溫 至120 °C ± 0.2 °C
- 每只晶体於載盘上独立温控，以增加整盘晶体的温度平均性及精準度
- 可选工前和工後測量，进行合格/不合格分选
- 於完成微调後，显示结果於画面，进行品质监控，不影响下批次生产
- 测试头采用柔性电路板设计，提升接触针使用寿命和改善接触可靠性，从而大幅降低更换接触针的运作成本



科研精密科技有限公司 科研集团
 总部：香港荃湾柴湾角街84-92号顺丰工业中心24字楼C座
 研创自动化设备(惠州)有限公司
 广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路A-02号 ZIP 516025



+852 - 3511 2388

kolinker@kolinker.com



+852 - 3511 2300

https://www.kolinker.com

技术指标

- 测试系统 KH1800 /KH1820 PI网络晶体测试系统
- 频率范围 KH1800 (1-120MHz) 或KH1820 (1-240MHz)
- 微调精度 $\pm 1\text{ppm}$ typical at Fr
- 离子源 阳极膜线性离子源
(Anode Layer Magnetron Ion Source)
- 真空系统 机械泵及分子泵 (Turbo pump)
- 微调载盘数量 1 只
- 载盘尺寸⁽²⁾ 48位 (8x6)载盘
- SMD 晶体尺寸⁽²⁾ 6035, 5032, 3225, 其它尺寸可商議...
- 电源 AC380V 三相, 50Hz, 约4KVA
- 冷却水要求⁽³⁾ 约 2Kgf/cm² , 3L/min. 温度約19°C 至21°C
- 軟件 OS Win7-32 bit
- 压缩空气要求 5Kgf/cm²
- 氩气 (Ar) 5-30 sccm
- 外形尺寸 约1550(W) x 1250(L) x 1250(H) mm (不含灯柱)

系统配置及选项

系统配置

- 主机 1套
- 分子泵 1套
- 机械泵 1套
- KH1800 PI网络晶体测试系统 1套

选项

- 无油泵
- 冷凝泵 (Cryo Pump)
- 冷水机

- (1) 视乎所选载盘, 数量会有所不同
 (2) 其它尺寸, 请与科研联络
 (3) 建議使用去离子水/蒸馏水

上述规格如有更改, 恕不另行通告。以上产品图片只供参考。



科研精密科技有限公司 科研集团
 总部:香港荃湾柴湾角街84-92号顺丰工业中心24字楼C座
研创自动化设备(惠州)有限公司
 广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路A-02号 ZIP 516025

+852 - 3511 2388
 kolinker@kolinker.com

+852 - 3511 2300
<https://www.kolinker.com>